【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年8月3日(2017.8.3)

【公開番号】特開2016-152403(P2016-152403A)
【公開日】平成28年8月22日(2016.8.22)
【年通号数】公開・登録公報2016-050
【出願番号】特願2015-30918(P2015-30918)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　27/14　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/288　(2006.01)
Ｃ２３Ｃ　18/32　(2006.01)
Ｇ０２Ｂ　5/20　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　27/14　Ｄ
Ｈ０１Ｌ　21/288　Ｅ
Ｃ２３Ｃ　18/32
Ｇ０２Ｂ　5/20　１０１

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月22日(2017.6.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
遮光体を含む光学装置の製造方法において、
基板を準備する工程と、
前記基板上にＣｏ－Ｗ－Ｂを含むめっき液を供給して無電解めっき処理を施すことによりＣｏ－Ｗ－Ｂを含むめっき層を形成する工程と、
を備えたことを特徴とする遮光体を含む光学装置の製造方法。
【請求項２】
遮光体を含む光学装置の製造システムに光学装置の製造方法を実行させるためのコンピュータプログラムを格納した記憶媒体において、
光学装置の製造方法は、
基板を準備する工程と、
前記基板上にＣｏ－Ｗ－Ｂを含むめっき液を供給して無電解めっき処理を施すことによりＣｏ－Ｗ－Ｂを含むめっき層を形成する工程と、
を備えたことを特徴とする記憶媒体。